



ПОЛЮС БАС

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 6000 PECVD

**Техническая
информация**

Установка осаждения MR SEMI 2000 / 6000 PECVD



Системы плазмохимического газофазного осаждения с одновременной обработкой нескольких пластин – до 6 шт. Предназначены для серийных производств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная конфигурация	MR SEMI 2000 PECVD	MR SEMI 6000 PECVD
Тип камеры	Загрузка нескольких пластин	
Процессы	PECVD	
Количество модулей	Процессный модуль-1 Охлаждение - 1	Процессный модуль -до 2 Охлаждение -1
Реакционный источник	Силан / TEOS	
Диаметр пластин	4", 6", 8"	
Платформа	четырёхугольная	шестиугольная
Генератор плазмы	13,56 МГц, 5000 Вт или 400 кГц, 1000 Вт	
Нагрев пластины	Макс. температура 400°C	
SMIF	Доступен	

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbас.ru 🌐 www.polusbас.ru